

テーマ

「次世代半導体の社会実装を加速する技術フォーラム」

～地域企業の強みを活かしたネットワークを活用し次世代半導体新事業創生を目指す～

日時

2017年3月6日(月) 14:00～17:00

場所

キャッスルプラザ 4階 梓の間

名古屋駅 ユニモール地下街11番出口すぐ

《プログラム》

14:00～14:10 主催者挨拶 江龍 修 教授

(名古屋工業大学 副学長 産学官連携センター長)

14:10～15:25 株式会社斉藤光学製作所

千葉 翔悟 氏 (社長室 室長)

「先進半導体基板の加工技術動向と課題

－ 価値最大化を実現する加工プロセスを考える －」

土田 益広 氏 (取締役 結晶事業部 部長)

「斉藤光学製作所におけるGaN等硬脆材基板加工への取り組み」

15:25～15:35 休憩(参加者情報交換)

15:35～16:00 太平洋セメント株式会社 増田 賢太 氏

(中央研究所 第3研究部 先進材料チーム リーダー)

「機能性マテリアル開発の取り組みと半導体関連材料のご紹介」

16:00～16:25 分島 彰男 准教授

(名古屋工業大学 電気・機械工学専攻 電気電子分野)

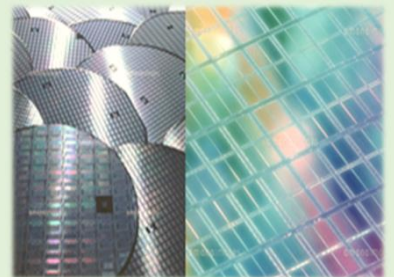
「IEDM2016報告 - GaN電子デバイスの最新技術動向 -」

16:25～16:40 土屋 洋一 特任教授

(名古屋工業大学 産学官連携センター)

「CES2017視察報告 - 無線電力伝送関係を中心に -」

16:40～17:00 フリーディスカッション ファシリテーター: 江龍 修 教授



参加費:無料 / 会場定員:40名(先着順)

申込先(Eメール): nit-semiconductor-seminar@adm.nitech.ac.jp

■お問合せ先 : 名古屋工業大学 産学官連携センター
〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町字木市29番
TEL:052-735-7519 FAX:052-735-5542